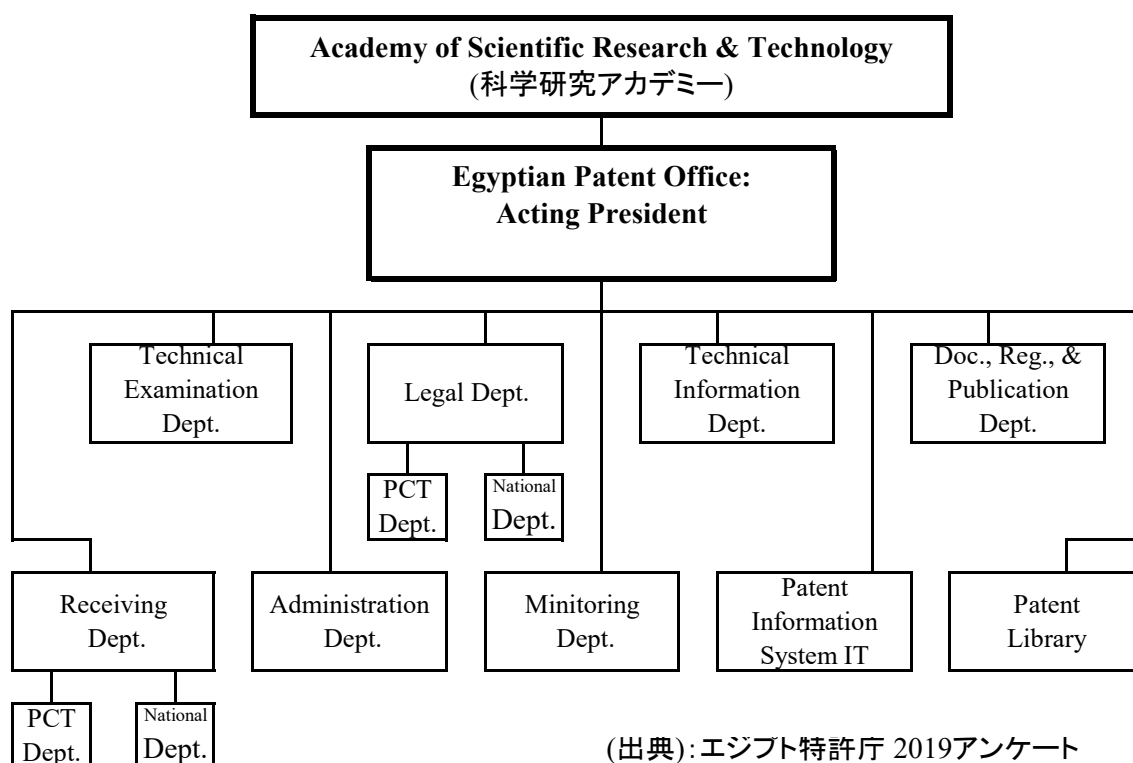


国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)				
名称	(Patent) Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research / Egyptian Patent Office				
	(Marks) Internal Trade Development Authority Ministry of Trade and Industry (ITDA) Trademarks and Industrial Designs Office				
所在地	(Patent) 101 Kasr El Ainy Street, P.O. BOX 11516 Cairo				
	(Marks) 4 Nasr Road cross Makram Ebeid Nasr City – Cairo				
連絡先	(Patent) (電話) (202) 279 21 274 / 291 /792 1272		(FAX) (202) 279 21 273		
	(E-mail) patinfo@egypo.gov.eg		(internet) www.egypo.gov.eg		
	(Marks) (電話) (202) 267 20 452		(FAX) (202) 267 20 453		
	(E-mail) egypt.id@gmail.com		(internet) WWW.ITDA.GOV.EG		
組織の長	Egyptian Patent Office		Egyptian Trademark Office		
	Acting President, Egyptian Patent Office: Dr. Mona Mohamed Yahia		Head: Mr. Mohamed Abdel Fatah		
沿革	(1) エジプトにおいては、1939年の行政命令により商標の保護が開始された。また、1949年に特許、意匠、工業的雛型法が制定され、1951年の行政命令230号により施工規則が施工されて特許、意匠、工業的雛型の保護が開始された。				
	(2) エジプト特許庁は、1951年法律第132号により1951年に設立され、1971年から科学研究技術院 (Academy of Scientific Research & Technology) に所属している。				
	(3) 2002年法律第82号の新法が2002年6月3日に施行され、これによりTRIPS協をクリアすることになった。また製薬製品が2005年末から保護されるようになった。				
	(4) 2002年法律第82号の新法の2002年6月3日の施行により、実用新案、半導体集積回路の回路配置				
所管	特許、実用新案、意匠、商標、著作権、半導体集積回路の回路配置の保護、秘密情報の保護、商号、原産地名称表示				
加盟条約	WIPO	ベルヌ	ブリュッセル	フィルム登録	マドリッド(原産地表示)
	1975/4/21	1977/6/7			1952/7/1
	ナイロビ(オリンピック)	パリ	PLT	レコード保護	ローマ
	1982/10/1	1951/7/1		1978/4/23	
	シンガポール	TLT	ワシントン	WCT(著作権)	WPPT(演奏及びレコード)
		1999/10/7			
	ブタペスト	ヘーグ			
		ロンドンアクト	ヘーグアクト	ジュネーブアクト	リスボン
		1952/7/1		2004/8/27	
	マドリッド(標章)	マドプロ	PCT	ロカルノ	ニース
1952/7/1	2009/9/3	2003/9/6		2005/6/18	
strasbourg	ウィーン	WTO			
1975/10/17		1995/6/30			

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)					
統計データ	出願件数		2017年	2018年	2019年	2020年
	特許	全数	2,279	2,255	2,183	2,207
		(内 外国出願)	1,254	1,258	1,156	1,229
		(内 日本から)	86	120	87	97
		(内 PCTルート)	1,226	1,226	1,123	1,199
	実用新案	全数				
		(内 外国出願)				
	意匠	全数	2,391	2,009	1,998	181
		(内 外国出願)	328	341	278	180
		(内 日本から)	7	25	25	3
	商標	全数	21,947	24,546	26,129	4,005
		(内 外国出願)	7,302	8,319	8,242	4,004
		(内 日本から)	98	216	214	88
	登録件数		2017年	2018年	2019年	2020年
	特許	全数	581	690	747	495
		(内 外国出願)	485	530	747	430
		(内 日本から)	57	68		23
		(内 PCTルート)	475	524	562	404
	実用新案	全数				
		(内 外国出願)				
意匠	全数	851	1,183	973	193	
	(内 外国出願)	299	258	312	192	
	(内 日本から)	11	28	25	3	
商標	全数	9,118	12,271	14,295	4,726	
	(内 外国出願)	6,742	6,829	8,068	4,726	
	(内 日本から)	139	209	231	120	
出典: WIPO IP Statistics						

組 織

<組織図> 特許局はAcademy of Scientific research and Technology (ASRT、科学研究及び技術アカデミー)の、商標及び意匠の登録所はAdministration for Commercial Registration, Ministry of Supply and Internal Trade(生活用品及び国内取引省・商業登録所)の下部組織である。



(出典): エジプト特許庁 2019アンケート

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
特許制度	②最新特許法の施行年月日	2002年 6月 3日施行 (2002年法律第82号)
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	発明者及び承継人(自然人、法人)
	⑥現地代理人の必要性及び代理人の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。 (知財法規則第52条)
	⑦出願言語	アラビア語 ただし、要約書についてはアラビア語及び英語を出願の際に添付しなければならない
	⑧特許権の存続期間及び起算日	出願日又は優先権主張があるときは優先主張日から20年。 (知財法第9条)
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物 (知財法第3条)
	⑩グレースピリオド	有。次の事項が規定されている。 ・国内又は国際の博覧会における開示の日から6月 (知財法第3条)
	⑪非特許対象	(1)公序良俗に反する発明、又は環境、人類、動植物の生命若しくは健康を損ねる可能性がある発明 (2)発見、科学理論、数学的方法、プログラム及び計画 (3)人間及び動物に対する診断法、治療法及び外科的治療方法 (4)その希少性は又は特性は問わない動植物、並びに微生物以外の動植物の生産のための非生物学的方法及び微生物学的方法 (5)臓器、組織、生体細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム (知財法第2条)
	⑫実体審査の有無及び審査事項	有。 (知財法第16条)
	⑬審査請求制度の有無	無。 (知財法第16条)
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願要件を満たしているときは出願の受理が公告(公開)される。 (知財法第16条)
	⑯異議申立制度の有無	有。出願の公告日から60日以内に利害関係人は異議を申立てることができる。 (付与前) (知財法第16条)
	⑰無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。
	⑱実施義務	有。登録日から3年、又は特許出願日から4年の何れか遅い方までに実施しないときは、強制実施権設定の対象となる。

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)				
⑱費用 単位 EGL (エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用]	出願料	150 EGL(学生以外) 0 EGL(学生)		
		審査手数料	2,000 EGL (学生は無料、個人は10EGL、教育研究機関は300EGL、職員が10人未満の企業は500EGL)		
		登録料			
		[特許権の維持に掛かる費用]			
		年金	(職員が10人以上の企業) (個人・職員が10人未満の企業) (学生)		
		2年次	20 EGL	10 EGL	2 EGL
		3年次	40 EGL	20 EGL	4 EGL
		4年次	80 EGL	40 EGL	8 EGL
		5年次	100 EGL	50 EGL	10 EGL
		6年次	150 EGL	75 EGL	15 EGL
		7年次	200 EGL	100 EGL	20 EGL
		8年次	250 EGL	125 EGL	25 EGL
		9年次	300 EGL	150 EGL	30 EGL
		10年次	350 EGL	175 EGL	35 EGL
		11年次	400 EGL	200 EGL	40 EGL
		12年次	500 EGL	250 EGL	50 EGL
		13年次	600 EGL	300 EGL	60 EGL
		14年次	700 EGL	350 EGL	70 EGL
		15年次	800 EGL	400 EGL	80 EGL
		16年次	900 EGL	450 EGL	90 EGL
		17年次-20年次	1,000 EGL(毎年)	500 EGL(毎年)	100 EGL(毎年)
⑳料金減免措置の有無	有。学生、個人、職員数が10人未満の企業は出願手数料、審査手数料及び年金が減免				
㉑PCTにおける国内料金減額措置の有無	無。				

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
実用新案 制度	②最新実新案法の施行年月日	2002年6月3日施行(2002年法律第82号)
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	考案者及び承継人(自然人、法人)
	⑥現地代理人の必要性及び代理の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。 (知財法規則第52条)
	⑦出願言語	アラビア語
	⑧実用新案権の存続期間及び起算日	出願日から7年 (知財法第30条)
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物 (知財法第3条)
	⑩グレース・リオト	有。次の事項が規定されている。 ・国内又は国際の博覧会における開示の日から6月 (知財法第3条)
	⑪不登録対象	(1)公序良俗に反する発明、又は環境、人類、動植物の生命若しくは健康を損ねる可能性がある考案 (2)発見、科学理論、数学的方法、プログラム及び計画 (3)人間及び動物に対する診断法、治療法及び外科的治療方法 (4)その希少性は又は特性は問わない動植物、並びに微生物以外の動植物の生産のための非生物学的方法及び微生物学的方法 (5)臓器、組織、生体細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム(知財法第2条)
	⑫実体審査の有無及び審査事項	無。
	⑬審査請求制度の有無	無。
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願要件満たしているときは出願の受理が公告(公開)される。 (知財法第16条)
	⑯異議申立制度の有無	有。出願の公告日から60日以内に利害関係人は異議を申立てることができる。 (付与前) (知財法第16条)
	⑰無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。
	⑱実施義務	有。登録日から3年、又は特許出願日から4年の何れか遅い方までに実施しないときは、強制実施権設定の対象となる。
	⑲費用 単位 (エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料 100 EGL(学生以外) 0 EGL(学生) [実用新案権の維持に掛かる費用] 年金 (職員が10人以上の企業)(個人・職員が10人未満の企業 (学生)) 2年次 20 EGL 10 EGL 2 EGL 3年次 40 EGL 20 EGL 4 EGL 4年次 80 EGL 40 EGL 8 EGL 5年次 100 EGL 50 EGL 10 EGL 6年次 150 EGL 75 EGL 15 EGL 7年次 200 EGL 100 EGL 20 EGL

<p>国名</p>	<p>Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)</p>	
	<p>⑩料金減免措置の有無</p>	<p>有。個人及び職員数が10人未満の企業は年金が減免される。</p>
	<p>⑪PCTにおける国内料金減額措置の有無</p>	<p>無。</p>

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
意匠制度	②最新意匠法の施行年月日	2002年 6月 3日施行 (2002年法律第82号)
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	創作者及び承継人(自然人、法人)
	⑥現地代理人の必要性及び代理人の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。
	⑦出願言語	アラビア語
	⑧意匠権の存続期間及び起算日	出願日から10年。更新により5年延長することができる。最長15年。 (知財法第126条)
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物
	⑩グレースピリオド	有。次の事項が規定されている。期間は開示日から6月。 ・公認の国内又は国際博覧会における展示による意匠の開示。 (知財法第120条(1))
	⑪不登録対象	(1)基本的に当該物の技術的又は機能的な要請により生じる形状を有する意匠 (2)エジプト又はその他の国の紋章、宗教的象徴、印章を含む意匠、又はその引用に が公序良俗に反する意匠 (3)登録商標又は周知の標章と同一、類似又は酷似する意匠 (知財法第124条)
	⑫実体審査の有無	無。
	⑬審査請求制度の有無	無。
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮部分意匠制度の有無	有。部分意匠も意匠の要件を満たすものは登録される。
	⑯関連意匠制度の有無	無。
	⑰「組物」の意匠制度の有無	無。
	⑱意匠分類	国際分類(ロカルノ分類)を採用している。(ロカルノ協定には未加盟)
	⑲出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、方式要件を満たしているときは公報により公告(公開)される。
	⑳秘密意匠制度の有無	無。
	㉑異議申立制度の有無	有。利害関係人は、出願の公告日から30日以内に異議を申立てることができる。 (知財法第122条, 知財法規則第89条、第130条)
	㉒無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。 (知財法第133条)
	㉓登録表示義務	無。

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
②④費用 単位 EGL (エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用]	
	出願料	87 EGL(1意匠につき) 56 EGL(1超の各意匠につき)
	登録料	120 EGL
	[意匠権の維持に掛かる費用]	
②⑤料金減免措置 の有無	存続期間更新料	120 EGL
	無。	

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
商標制度	②最新商標法の施行年月日	2002年6月3日施行(2002年法律第82号)
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤商標法の保護対象	商品、役務、団体商標、証明商標 (知財法第63条、第69条、第70条)
	⑥商標の種類	文字商標、図形商標、記号商標、結合商標、色彩商標 (知財法第63条)
	⑦出願人資格	自然人、法人 (知財法第66条)
	⑧権利付与の原則	先願主義 (知財法第65条)
	⑨本国登録要件	
	⑩現地代理人の必要性及び代理人の資格	知財法、知財法規則には必要との規定は見当たらない。
	⑪出願言語	アラビア語 (知財法規則72)
	⑫商標権の存続期間及び起算日	出願日から10年。10年ごとに更新できる。 (知財法第90条)
	⑬グレースピリオド	有。次の事項が規定されている。 ・国内又は国際の博覧会における開示の日から6月 (知財法第72条、 第75条 、知財法規則83、85)
	⑭不登録対象	(1)顕著性に欠ける標章、又は製品についての単なる説明、写真、表示に過ぎないもののみ使用が認められるか、標準的な図面若しくはその画像である記号又は表示を構成する標章 (2)公序良俗に反する標章 (3)公的な紋章、旗章及びその他州、地域的若しくは国際的組織に関するその他の記章及びその模倣 (4)宗教上の特徴を表わす表象に同一又は類似する標章 (5)同意を得ていない個人の肖像又はその者の紋章 (6)出願人がそれに対する権利を自ら証明できない名誉学位の称号 (7)公衆を誤認又は混同させる可能性があるか又は物若しくはサービスであろうとも、商品の原産地又はその他の品質に関する虚偽の記述を含む標章及び地理的表示並びに虚偽の、模倣又は偽造された称号を含む標章 (知財法第67条)
	⑮防護標章制度の有無	無。
	⑯周知商標制度の有無	有。周知商標には、次のいずれかの要件が求められている。 (1)一般の消費者によく知られていること (2)(1)の要件を満たさないときには裁判所によって証明されていること (知財法第68条)
	⑰一出願多区分制度の有無	無。
	⑱実体審査の有無及び審査事項	有。出願は、登録要件、登録適格性、既登録商標との類似性が審査される。 (知財法第77条)
	⑲審査請求制度の有無	無。
	⑳優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	㉑出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願が受理されると公報により公告(公開)される。
	㉒異議申立制度の有無	有。利害関係人は、公告日より60日以内に異議申立を行うことができる。 (付与前) (知財法第80条)

国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
⑳無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、利害関係人は、無効を裁判所に提訴することができる。 (知財法第82条)	
㉑不使用取消制度の有無	有。5年。継続して5年間の不使用は、不使用取消の対象となる。 (知財法第91条)	
㉒商標分類	国際分類(ニース分類、第10版)を採用している。	
㉓図形要素の分類	国際図形分類(ウィーン分類)を採用している。(ウィーン協定には未加盟)	
㉔譲渡要件	無。商標は、営業とは関係なく譲渡することができる。 (知財法第87条)	
㉕費用 単位 EGL (エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料 50 EGL(1分類、1標章) 25 EGL(1超の各分類につき) 登録料 100 EGL(1分類、1標章) [商標権の維持に掛かる費用] 存続期間更新料 100 EGL	
㉖料金減免措置の有無	無。	